

PRODUCTION OF COMPOSITE SUBSTRATE FOR OPTICAL AND MAGNETIC DISK

Patent Number: JP61242327

Publication date: 1986-10-28

Inventor(s): SUZUKI SETSUO; others: 01

Applicant(s): SUMITOMO BAKELITE CO LTD

Requested Patent: JP61242327

Application Number: JP19850082279 19850419

Priority Number(s):

IPC Classification: G11B5/84; G11B5/704; G11B7/26

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To obtain the titled substrate for an optical and a magnetic disk having a resinous layer to whose metallic sheet surface a mirror surface is transferred, by coating a resinous composition obtained by incorporating a photosensitizer into a resin dissolved in a specified compd. on the surface of a metallic sheet or a specular sheet treated with a coupling agent and curing the resinous layer by irradiating UV rays.

CONSTITUTION: Triacrylate or trimethyl methacrylate having an isocyanurate skeleton shown by formula (10) is used as the essential component and 1 kind of liq. compd. selected from a multifunctional aryl compd. and an acryl or a methacryl compd. having a heterocyclic ring is mixed and heated to obtain a material which is liq. at ordinary temp. A photosensitizer is incorporated into the material to obtain a resinous composition. The composition is loaded on the surface of a metallic sheet treated with a coupling agent or a specular sheet having UV-ray transmissivity and the specular surface and the surface of the metallic sheet are oppositely pressed on each other to form a thin resinous film. UV rays are irradiated from the specular surface side to cure the resin and the specular sheet is removed. A thin and light-weight composite sheet for an optical and a magnetic disk formed with a photosetting coated film, hence having excellent surface smoothness and heat resistance and having 1-3μm thickness can be obtained.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

④ 日本国特許庁 (JP) ① 特許出願公開
 ② 公開特許公報 (A) 昭61-242327

③ Int. Cl. 1
 G 11 B 5/84 7314-5D
 5/704 7350-5D
 7/26 8421-5D 審査請求 未請求 発明の数 1 (全 4 頁)

④ 発明の名称 光・磁気ディスク用複合基板の製造方法

④ 特願 昭60-82279
 ④ 出願 昭60(1985)4月19日

④ 発明者 鈴木 節夫 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト
 株式会社内

④ 発明者 坂本 有史 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト
 株式会社内

④ 出願人 住友ベークライト株式 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号
 会社

明細書

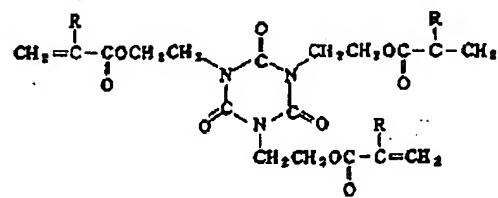
ることを特徴とする光・磁気ディスク用複合基板
 の製造方法。

1 発明の名称

光・磁気ディスク用複合基板の製造方法。

2 特許請求の範囲

金属板の片面または両面に樹脂薄膜を形成してなる光・磁気ディスク用基板を製造する方法において、下記の式(1)で示されるイソシアヌレート骨格を有するトリアクリレート又はトリメチルメタアクリレートを主成分とし、これに複素環を有する多官能アリール化合物、またはアクリルまたはメタアクリル化合物の中から選択された1種以上の液状化合物を加熱混合し、常温下で液状となるようにし、これに光増感剤を配合した樹脂組成物を、カップリング剤処理した金属板裏面上又はUV光透過性を有する鏡面板上に積載し、該鏡面と金属板裏面を対向圧接し、薄い樹脂膜を形成し、該鏡面側よりUV光を照射し樹脂を硬化させ、しかる様に鏡面板を除去することにより金属板の片面または両面に鏡面を有する樹脂硬化薄膜を形成す



(式中 R は H または CH₃ を示す。)

3 発明の詳細な説明

本願発明は選択された紫外線硬化樹脂樹脂層と金属板とが一体複合化された、表面平滑性、剛性、耐熱性、生産性に優れた光・磁気ディスク用複合基板の製造方法に関するものである。

近年記憶容量の大きい光ディスクや磁気ディスクの開発が盛んになり、これに伴ないディスク用基板に対する要求性能も一段の飛躍を加えつつある。磁気ディスク基板についてみると、磁気樹脂膜形成時の表面平滑性、樹脂膜アニール時の高

特開昭61-242327 (2)

因に耐えるための耐熱性、磁気ヘッド接触運動時の耐摩耗性、トランクリング時の高速回転に耐えるための重量性、剛性、安価に製造可能であるという経済性等の性能が強く要求される。これら要求に対応するため開発したハードディスクと呼ばれる磁気ディスク基板は従来1~3%厚のアルミニウム等の金属板が広く用いられ、該金属板上にNi-Co合金、Gd-Tb-Pe合金等の磁性機能膜をスパッタ法で積層し磁気ディスクを得るのが一般的である。

しかしながら金属板を基板として用いた場合剛性、耐熱性は良好であるものの、表面平滑性を得るためにには多大な工数を要する研磨工程に依らなければならず、加えて表面硬度が低く傷つき易いといった重大欠点を有している。

これらの欠点を解消する方法として合成樹脂板を基板として用いることも提案されている。しかしながらこの基板は鏡面を有する成形型の表面を転写することにより平滑性に優れた基板が比較的容易に得られるものの、金属板に比較した場合耐

に曲げ剛性に優れた金属板と選択された紫外線硬化樹脂系樹脂から形成されており、且つ表面平滑性、耐熱性に優れた厚さ1~3μの薄くて軽量である光・磁気ディスク用複合板を提供せんとする目的で成された発明である。

即ち本発明はカッティング剤処理された金属板表面または鏡面板表面にトリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアール酸のアクリル酸またはメタアクリル酸エステルを複数層を有する多官能アリールおよび/又はアクリルおよび/又はメタアクリル酸状化合物に溶解せしめた樹脂系に増感剤を混してなる樹脂組成物を存在せしめ、金属板間に鏡面板面が対向するように積載し、該樹脂を鏡面体を通して紫外線照射により硬化せしめその後鏡面板を除去することにより金属板間に鏡面の転写された樹脂層を有する光・磁気ディスク用基板を提供せんとして成された発明である。

以下に本発明の詳細につき述べる。

本発明で用いられる金属板は1~3mmの、アルミニウム表面アルマイト処理アルミニウム、鉄板、ステ

ル性、剛性に著しく劣り現実的に使用困難であるのが実情である。

またこれらの両基板の長所を生かす方法として複合基板を用いることも提案されており、具体的には金属板上に耐熱性の樹脂ワースをコーティングし、乾燥により溶媒を除き必要に応じて熱硬化せしめる方法である。

しかしながらスピナーコート法、ロール転写コート法では表面平滑性を得ることは必ずしも限界があり、加えて溶媒除去時および高湿時に小さなシワが表面に生じ満足な基板を得ることは不可能に近いまた得られたとしても樹脂の硬化に高湿長時間を要するため経済的にも問題である。

一方耐熱性を重視する意味でUV硬化樹脂が考えられるが通常の樹脂系では耐熱性が全く得られず冷熱操作試験でクラックを生じ全く実用的意味を成さない。光ディスク基板についても同様に表面平滑性が優れた金属板と合成樹脂との複合基板は未だ実用化に到っていない。

本発明はこれらの光・磁気ディスク基板の現状

シレス板等であり、特に重量という観点からアルミニウム板が好ましい。また使用される樹脂層の密着性向上のために、表面粗化された金属板も好んで用いられる。更に同様な目的でビニルシラン、エポキシシラン、アミノシラン等の潤滑性カッピング剤で金属板表面を処理することは有効である。また鏡面体としてはUV光透過性が良好なこと、表面平滑性が良好であることからガラス板が用いられる。特に表面研磨された光ディスク等の基板に用いられるガラス板の使用は特に好ましい。

この様な金属板上又は鏡面板上に次いで無溶剤液状樹脂を滴下し、該樹脂を拘束するように両板を重複する。この際必要に応じて樹脂層の厚み調整の為スペーサーを用いることも適宜可能であるし、片面および両面にコートすることも適宜可能である。

またこの鏡用いられる樹脂としては以下の性能を満足する必要がある。

1 耐熱性が必須であり、250°C~300°Cの熱処理により鏡面の張り、クラック、アルミニウム等

特開昭61-242327 (3)

- 基板の耐熱、着色等が無いこと。
- 1. 冷熱繰返し(120℃～-40℃)のヒートショックに耐えること。
- 2. 耐摩耗性を有していること、および表面硬度の高いこと。
- 3. 基板との密着性に優れていること。
- 4. 磁性塗料等の溶剤に耐えること。
- 5. 短時間で塗装形成能の有ること。
- 6. 無溶剤系樹脂であること。

等でありこれらを要求性能をすべて満足する樹脂として前記樹脂組成物を見い出し、不可能とされていた複合基板製造を可能とした。即ちトリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌール酸のトリアクリル酸またはトリメタアクリル酸エステルを主成分とし、該樹脂は常温で固形であるため、これに被覆層を有する液状ポリアクリレート又はポリメタアクリレート樹脂を添加し加温しながら溶解せしめる。被覆層を有するポリアクリレートは液状であればすべて使用可能である。一例を挙げればイソシアヌール酸、シアヌール酸、エピロアセ

てこれを硬化せしめ、最終的に鏡面体を剥離除去して鏡面が硬化樹脂表面に転写された表面平滑性に優れた複合基板を得ることが出来る。また得られた複合板の熱アニール処理も歪除去の目的に有効な方法である。

本発明に従うと金属板を表面仕上げする多大な工数が不要となり、金属板の剛性を有しつつ、表面は平滑性に優れた転写鏡面を有する硬化樹脂層を有し、樹脂層は被覆層を有する硬化層であるため耐熱耐光性に優れ280℃30分の熱処理に耐しても表面平滑性の変化、着色等は全く認められないといった薄くべき複合基板であり光・磁気ディスクに必要とされる条件をすべて具备した最適基板であった。

以下に実施例を挙げる。

実施例

トリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌール酸のトリアクリレート80重量部とトリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌール酸のジアクリレート20重量部を50℃にて溶解させた後、

タール環、イミダゾール環、トリアジン環等の環状化合物を含有するポリアクリレートが挙げられる。

溶解後これを冷却し、ベンゾフェノン、アセトフェノン、ベンゾソイソブチルエーテル等の増感剤を添加し樹脂組成物とする。配合比率は固形樹脂/液状樹脂の重量比率で100/10～100/90の範囲が好ましく固形樹脂がこの範囲より多い場合は高粘度物になり成形性に欠けるし液状樹脂が多い場合は耐熱性及び表面硬度の高い物が得難い。

また樹脂組成物の塗布厚みは100μ以下であってできるだけ薄膜であることが必要でありこれより被覆層を厚くした場合高溫処理においてクラックを発生する。また該樹脂組成物中に硬化物の熱膨脹係数の減少、熱伝導率の向上、表面硬度の向上、その他各種機械特性等を目的に各種無機フィラーを添加することも適用いられる方法である。この場合UV光透過性を考慮したシリカ系粉末の添加は特に重要である。かくして得られた樹脂組成物はガラス鏡面体を通して樹脂層にUV光を照射し

鏡面に冷却し、2-ヒドロキシ-ヘキシルフェニルケトン3重量部を加え、完全に溶解させた。得られた樹脂をサンドブラスト、シランカップリング処理したアルミニウム基板上に塗布し、両面をガラス板で圧縮し、80Wの紫外線ランプを高さ15cmから、90秒照射し、脱型後さらに60秒照射し、両面がUV硬化樹脂でコートされた複合基板を得た。基板の主な特性を第1表に示す。

特開昭61-242327 (4)

第 1 表

基板特性	検査条件	
密着性(漆喰目)	常温	100/100
・(・)	E-20'/280℃	100/100
表面粗さ	常温	$R_a=0.005 \mu \text{m}$ $R_{max}=0.04 \mu \text{m}$
・	E-20'/280	$R_a=0.006 \mu \text{m}$ $R_{max}=0.04 \mu \text{m}$
熱抵抗性外観	E-20'/280	着色等無ナシ
熱サイクル試験	125℃(80分) → -40℃(30分)	密着性、クラック等異常ナシ
	100 cycles	

第1表でわかる様に本発明で得られた基盤は表面平滑性が優れ、耐熱性良好な基板である。